



(21) 申請案號：109207908

(22) 申請日：中華民國 109 (2020) 年 06 月 22 日

(51) Int. Cl. : A61F5/14 (2006.01)

(71) 申請人：紅崑科技股份有限公司(中華民國) (TW)

臺南市安南區工業一路 23 號

(72) 新型創作人：謝進興 (TW)

(74) 代理人：高玉駿；楊祺雄

申請專利範圍項數：7 項 圖式數：4 共 14 頁

(54) 名稱

具量子能量的足弓矯正器

(57) 摘要

一種具量子能量的足弓矯正器，包含一足弓矯正器本體與一設置在該足弓矯正器本體的能量單元。該足弓矯正器本體包括一前後延伸並上下弧彎的足弓部，該足弓部具有一凹設在其底面的凹槽。該能量單元設置在該凹槽中，並包括一量子能量晶片。使用該具量子能量的足弓矯正器時，該量子能量晶片可透過來自腳掌的溫度而被啟動並持續發出具量子能量的電磁波生物訊息，所述電磁波生物訊息可穿透該足弓矯正器本體進而抵達足部並促進足部的血液循環，使得在使用該具量子能量訊息的足弓矯正器的過程中，能達到舒緩足部緊繃並增進足部健康的效果。

指定代表圖：

符號簡單說明：

1: 具量子能量的足弓矯正器

2: 足弓矯正器本體

21: 足弓部

210: 凹槽

22: 足跟部

3: 能量單元

5: 固定件

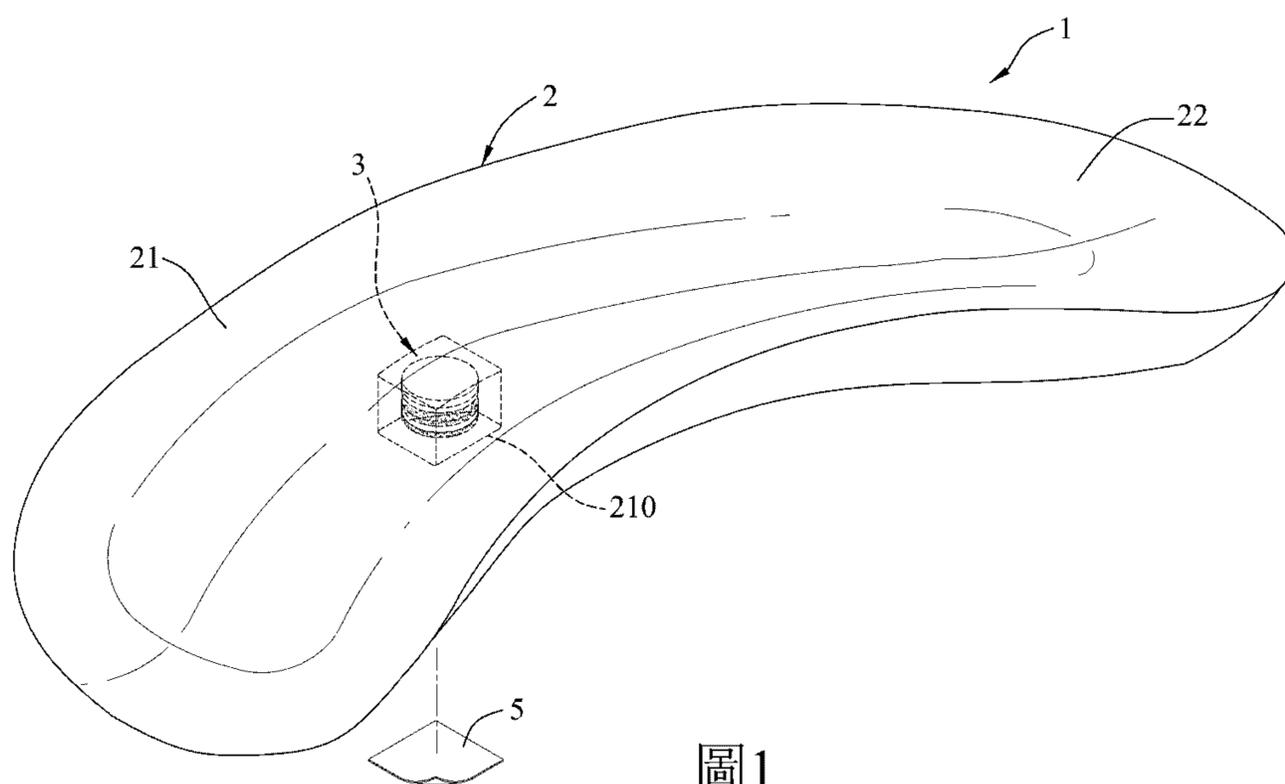


圖1



M600603

【新型摘要】

【中文新型名稱】 具量子能量的足弓矯正器

【中文】

一種具量子能量的足弓矯正器，包含一足弓矯正器本體與一設置在該足弓矯正器本體的能量單元。該足弓矯正器本體包括一前後延伸並上下弧彎的足弓部，該足弓部具有一凹設在其底面的凹槽。該能量單元設置在該凹槽中，並包括一量子能量晶片。使用該具量子能量的足弓矯正器時，該量子能量晶片可透過來自腳掌的溫度而被啟動並持續發出具量子能量的電磁波生物訊息，所述電磁波生物訊息可穿透該足弓矯正器本體進而抵達足部並促進足部的血液循環，使得在使用該具量子能量訊息的足弓矯正器的過程中，能達到舒緩足部緊繃並增進足部健康的效果。

【指定代表圖】：圖（1）。

【代表圖之符號簡單說明】

- 1……具量子能量的足弓矯正器
- 2……足弓矯正器本體
- 21……足弓部
- 210……凹槽
- 22……足跟部
- 3……能量單元
- 5……固定件

【新型說明書】

【中文新型名稱】 具量子能量的足弓矯正器

【技術領域】

【0001】 本新型是有關於一種足部矯正器，特別是指一種足弓矯正器。

【先前技術】

【0002】 腳掌足弓的形狀大置可分為扁平足、正常足，及高弓足，其中，扁平足與高弓足是由於站立時腳底相對於地面弓起的空間不足或太多而造成，因此行走時足部不易緩衝身體本身的重量及來自地面的反作用力，而產生各種足部不適的症狀。

【0003】 一種習知的足弓矯正鞋墊，包含一足跟部與一連接在該足跟部的足弓部，該足跟部對應於腳掌的腳跟區域，而該足弓部具有一定的曲率且能對應腳掌的足弓，因此能矯正過度弓起或過於扁平的足弓。然而，所述鞋墊為了有較佳的支撐力，往往需採用較硬的材質來製作，造成使用時容易產生足部的緊繃及不適感，因此，長時間使用這種足弓矯正鞋墊，可能會導致足部的疼痛，進而降低使用的意願。

【新型內容】

【0004】 因此，本新型之目的，即在提供一種能夠克服先前技術的缺點的足弓矯正器。

【0005】 於是，本新型一種具量子能量的足弓矯正器，包含一足弓矯正器本體與一設置在該足弓矯正器本體的能量單元。該足弓矯正器本體包括一前後延伸並上下弧彎的足弓部，該足弓部具有一凹設在其底面的凹槽。該能量單元設置在該凹槽中，並包括一量子能量晶片。

【0006】 本新型之功效在於：藉由將該能量單元設置在該足弓矯正器本體的該凹槽中，在使用該具量子能量的足弓矯正器時，該能量單元的該量子能量晶片會持續發出具量子能量的電磁波，所述電磁波可穿透該足弓矯正器本體進而抵達足部並促進足部的血液循環，使得在使用該具量子能量的足弓矯正器矯正足弓的過程中，能達到舒緩足部緊繃並增進足部健康的效果。

【圖式簡單說明】

【0007】 本新型之其他的特徵及功效，將於參照圖式的實施方式中清楚地呈現，其中：

圖 1 是一立體分解圖，說明本新型具量子能量的足弓矯正器的一實施例；

圖 2 是一立體分解圖，說明該實施例的元件相對關係；

圖 3 是一剖視圖，說明該實施例的一能量單元；及

圖 4 是一剖視圖，說明該實施例的元件相對關係。

【實施方式】

【0008】 參閱圖 1~4，本新型具量子能量的足弓矯正器 1 之一實施例，包含一足弓矯正器本體 2、與設置在該足弓矯正器本體 2 的一能量單元 3、數個黏合件 4，及一固定件 5。

【0009】 該足弓矯正器本體 2 包括相連的一足弓部 21 與一足跟部 22。該足弓部 21 是前後延伸且上下弧彎而用以貼靠於腳掌的足弓區域，該足跟部 22 是前後水平延伸地用以貼靠於腳掌的足跟區域。該足弓部 21 之底面設有多個凹槽 210，該等凹槽 210 的其中之一的位置是對應腳掌的湧泉穴。

【0010】 該能量單元 3 是設置在對應於腳掌之湧泉穴的該凹槽 210 中，並包括一量子能量晶片 31、兩個分別疊置在該量子能量晶片 31 之上下側的感應線圈層 32，及一疊置在位於該量子能量晶片 31 上方的該感應線圈層 32 的能量增益層 33。

【0011】 該量子能量晶片 31 依黑體輻射原理在被加熱升溫後可發出具有量子能量的電磁波。該量子能量晶片 31 的組成材料例如但不限於能產生遠紅外線的物質或能產生負離子之物質。

【0012】 每一感應線圈層32是以金屬線螺旋延伸製成，而根據共振原理，當電磁波頻率與所述環型線圈的自然頻率相同時，所述電磁波會與該等感應線圈層32產生共振而強化該量子能量晶片31與該等感應線圈層32周圍的電磁波能量密度。

【0013】 該能量增益層33的材料包括石墨烯，所述電磁波照射該能量增益層33而提升該能量增益層33的溫度，使得所述石墨烯在升溫後釋放出較強的遠紅外線。

【0014】 該等黏合件4是設置在該量子能量晶片31與該等感應線圈層32間、相鄰的該能量增益層33與該感應線圈層32間，而與該量子能量晶片31、該等感應線圈層32，及該能量增益層33黏固為一體。該等黏合件4例如但不限於熱融膠。

【0015】 該固定件5是嵌置在設置有該能量單元3的該凹槽210中，且會封閉該凹槽210而將該能量單元3限位於該凹槽210中，因此，在使用該具量子能量的足弓矯正器1的過程中，該能量單元3不會因該足弓矯正器本體2於走路產生的晃動與彈性變形而脫離。

【0016】 要以本實施例矯正足弓時，將該具量子能量的足弓矯正器1置入鞋中，而疊置於鞋墊的頂面，接著將腳掌伸入鞋中，使該足弓矯正器本體2的該足弓部21與該足跟部22能分別貼合於腳掌的足弓區域與足跟區域，接著，腳掌的溫度會透過熱傳導而傳遞至該足弓矯正器本體2與該能量單元3，因此所述量子能量晶片31

的溫度會逐漸上升而發出具有量子能量的電磁波。在所述具有量子能量電磁波的輻射作用下，該等感應線圈層32與所述電磁波產生共振而增強所述電磁波的能量密度，並以輻射升溫的方式激發該能量增益層33產生遠紅外線。

【0017】 所述電磁波與所述遠紅外線可向上傳播並抵達腳掌皮膚。由於該能量單元3的位置是對應於腳掌之湧泉穴，而湧泉穴為人體之足少陰腎經的起點，且對應的臟腑為腎臟，因此透過來自下方之該量子能量晶片31發出的所述電磁波與該能量增益層33發出的所述遠紅外線刺激湧泉穴，可達到促進血液循環與舒緩足部肌肉痠痛的功效。

【0018】 本實施例之所述感應線圈層32的數量為兩個，該等感應線圈層32的功能是透過共振原理而增強該量子能量晶片31周圍的電磁波密度，然而在實施時，在本新型的其他實施態樣中，也可以只設置一個所述感應線圈層32，或者是不設置所述感應線圈層32，而在不設置所述感應線圈層32的情況下，該量子能量晶片31與該能量增益層33仍會分別產生所述電磁波與所述遠紅外線。

【0019】 本實施例之該固定件5為一貼紙，但在實施時，在本新型的其他實施態樣中，該固定件5也可以是填充在設置有該能量單元3的該凹槽210中並覆蓋該量子能量晶片31的膠體，例如熱融膠。

【0020】 綜上所述，藉由將該能量單元3設置在該足弓矯正器本體2，在使用該具量子能量的足弓矯正器1時，該能量單元3會持續發出具量子能量的電磁波與遠紅外線，所述電磁波與遠紅外線可穿透該足弓矯正器本體2進而抵達腳掌與位於腳掌的湧泉穴，而可促進血液循環，並達到舒緩足部緊繃的效果。

【0021】 惟以上所述者，僅為本新型之實施例而已，當不能以此限定本新型實施之範圍，凡是依本新型申請專利範圍及專利說明書內容所作之簡單的等效變化與修飾，皆仍屬本新型專利涵蓋之範圍內。

【符號說明】

【0022】

- 1…… 具量子能量的足弓矯正器
- 2…… 足弓矯正器本體
- 21…… 足弓部
- 210…… 凹槽
- 22…… 足跟部
- 3…… 能量單元
- 31…… 量子能量晶片
- 32…… 感應線圈層
- 33…… 能量增益層
- 4…… 黏合件
- 5…… 固定件

【新型申請專利範圍】

【第1項】 一種具量子能量的足弓矯正器，包含：

一足弓矯正器本體，包括一前後延伸且上下弧彎而用以貼靠在腳掌之足弓區域的足弓部，該足弓部具有一凹設於其底面的凹槽；及

一能量單元，設置在該凹槽中，並包括一可發出具量子能量之電磁波的量子能量晶片。

【第2項】 如請求項1所述的具量子能量的足弓矯正器，其中，該能量單元還包括一疊置在該量子能量晶片上方且可發出遠紅外線的能量增益層，該能量增益層的材料包括石墨烯。

【第3項】 如請求項2所述的具量子能量的足弓矯正器，其中，該能量單元還包括一個疊置在該量子能量晶片與該能量增益層間的感應線圈層。

【第4項】 如請求項1所述的具量子能量的足弓矯正器，其中，該能量單元還包括兩個分別疊置在該量子能量晶片上下兩側的感應線圈層，及一個疊置在位於該量子能量晶片上方的該感應線圈層的能量增益層，該能量增益層的材料包括石墨烯。

【第5項】 如請求項1、2、3或4所述的具量子能量的足弓矯正器，其中，該凹槽對應於腳掌的湧泉穴。

【第6項】 如請求項5所述的具量子能量的足弓矯正器，還包含一設置在該凹槽中並可將該能量單元固定於該足弓矯正器本體的固定件。

【第7項】 如請求項6所述的具量子能量的足弓矯正器，其中，該固定件是黏貼固定在該凹槽的槽緣而封閉該凹槽，而將該能量單元限位在該凹槽中。

【新型圖式】

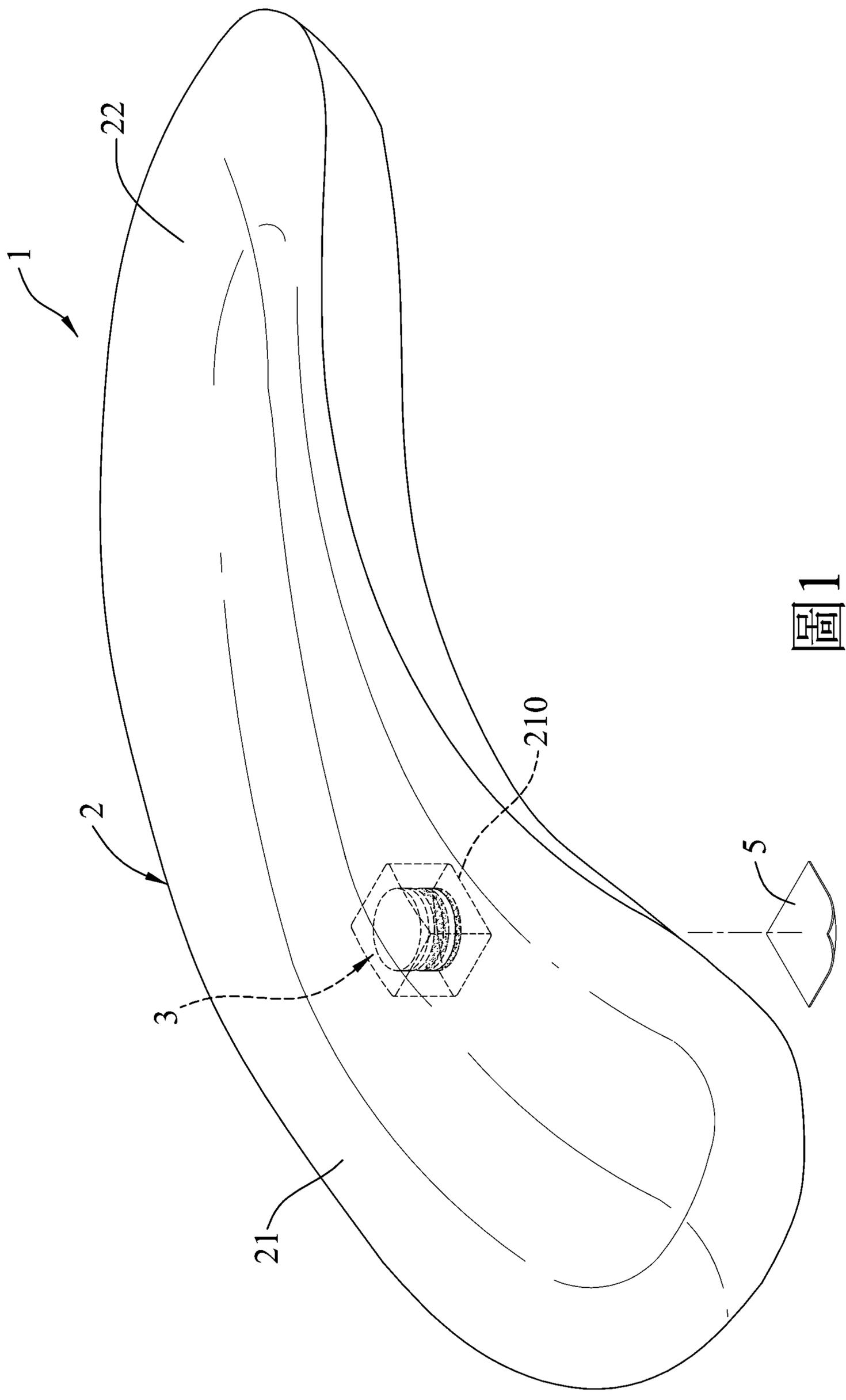


圖1

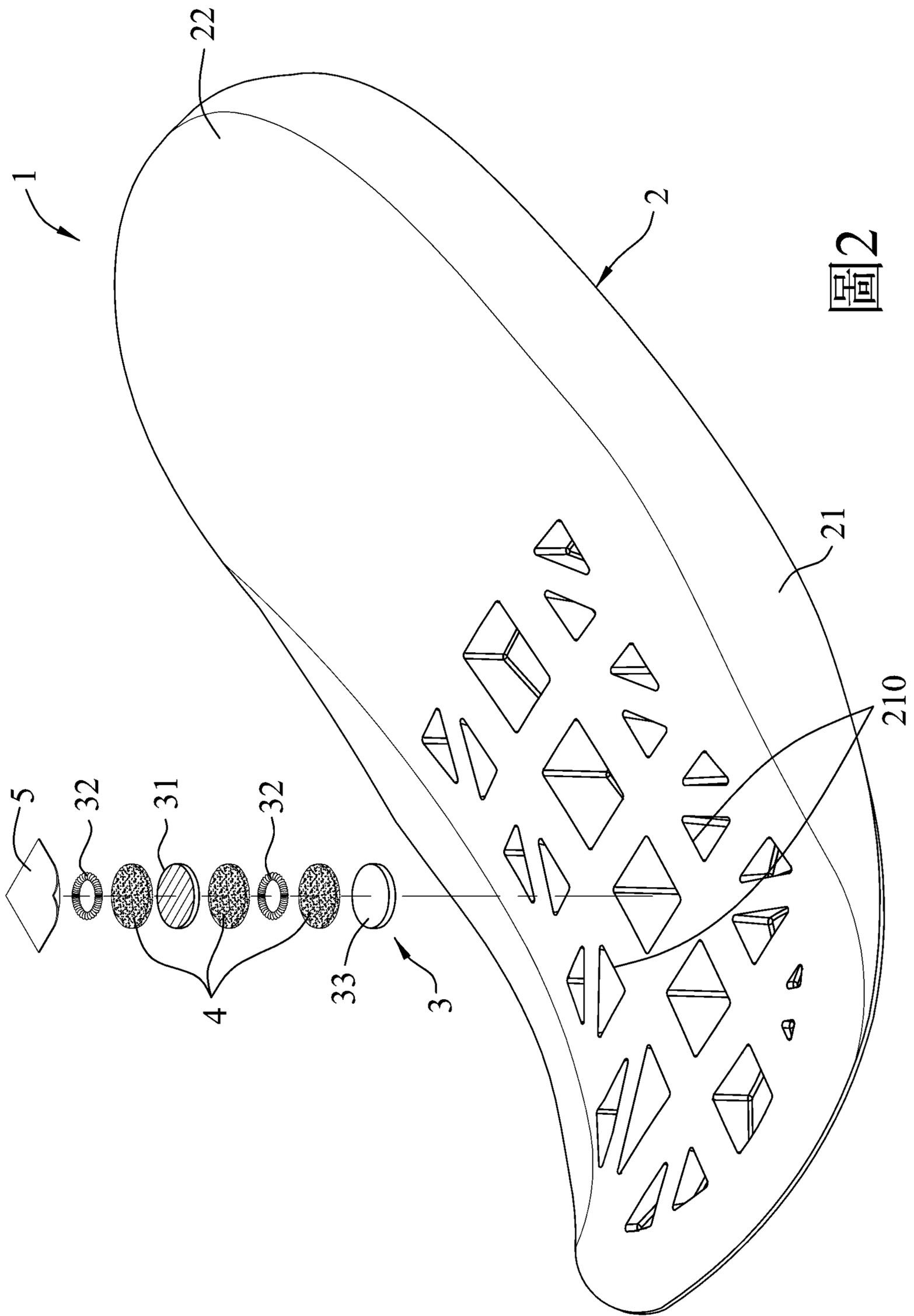


圖2

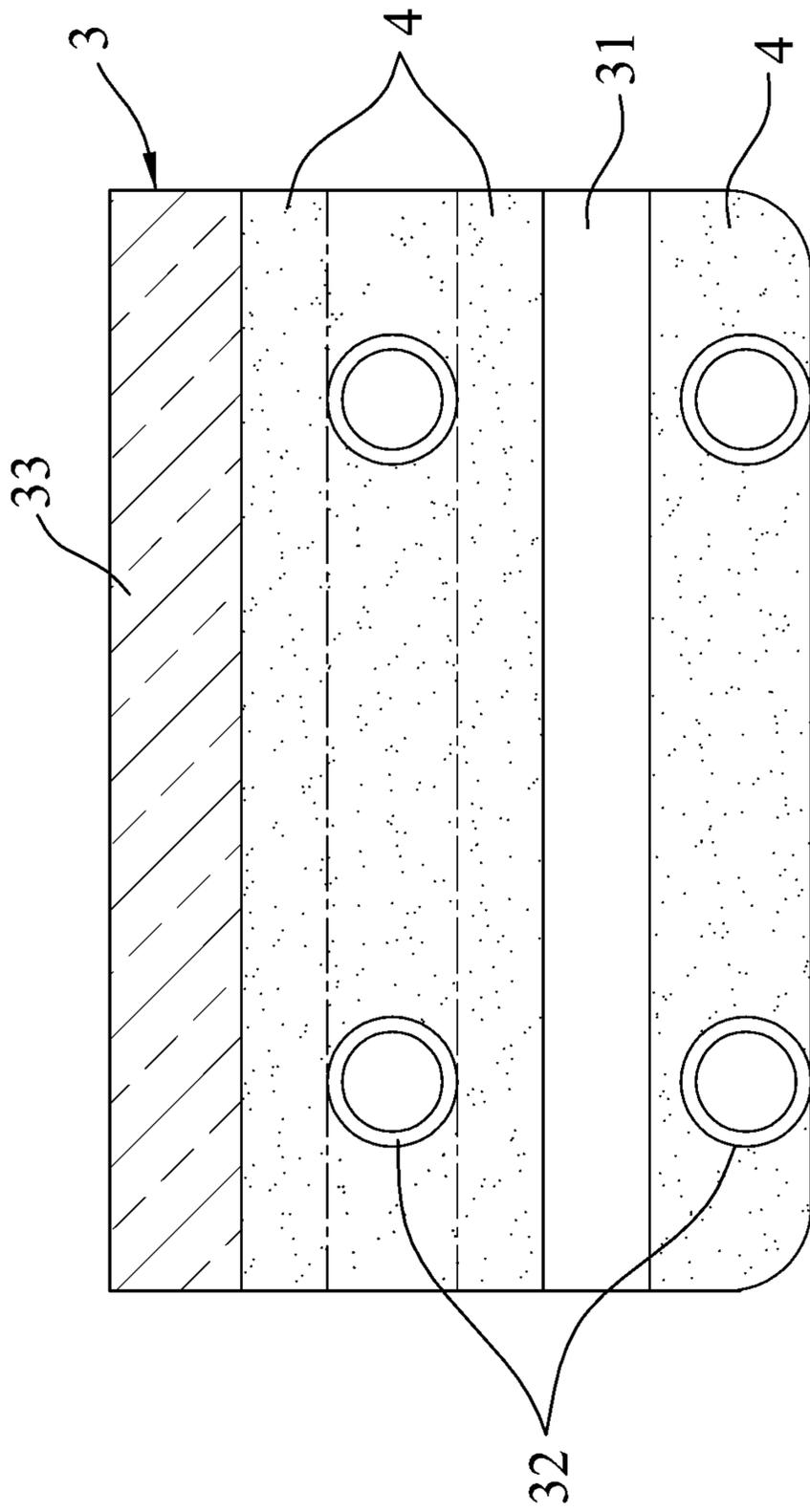


圖3

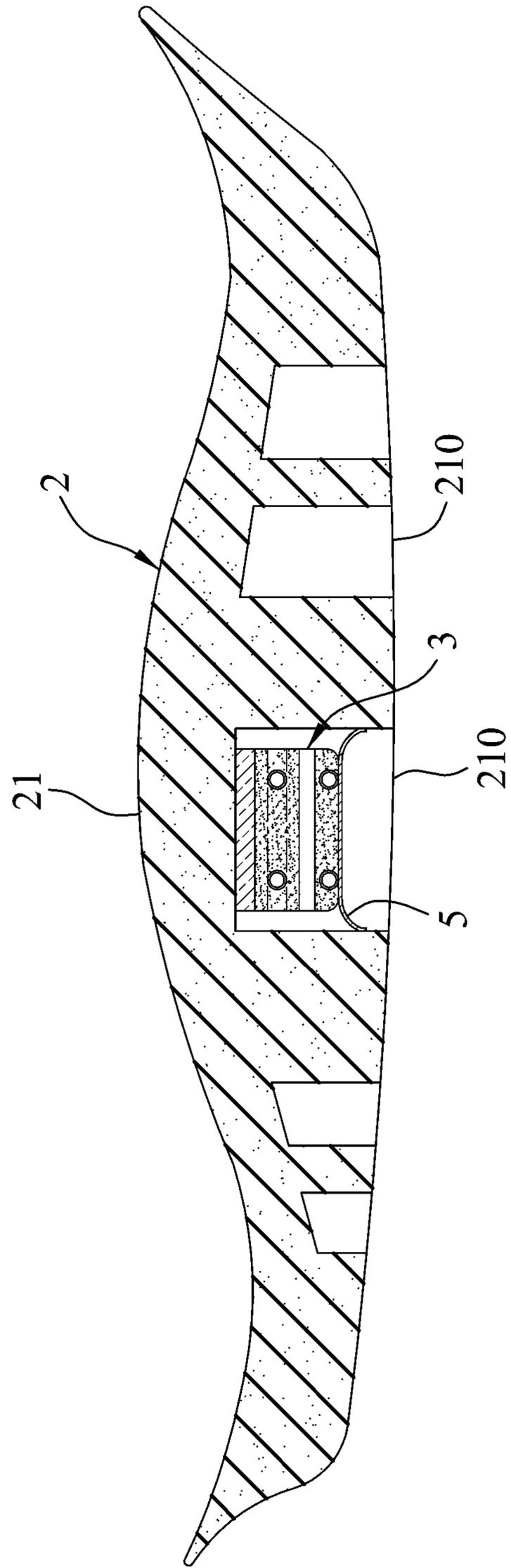


圖4